

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成22年8月5日 (2010.8.5)

【公開番号】特開2009-79276(P2009-79276A)

【公開日】平成21年4月16日 (2009.4.16)

【年通号数】公開・登録公報2009-015

【出願番号】特願2007-250735(P2007-250735)

【国際特許分類】

C 2 3 C 14/24 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 14/24 G

【手続補正書】

【提出日】平成22年6月22日 (2010.6.22)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

蒸着材料を蒸発させる蒸発源、

第 1 の回転軸に対して回転され、該蒸発源に対して対向配置される回転基板、及び

第 2 の回転軸に対して回転され、該回転基板を該蒸発源から部分的に遮蔽する回転膜厚

補正板

を備えた真空蒸着装置において、

該第 2 の回転軸が、該回転基板の周縁内に該第 1 の回転軸と離隔して規定され、

さらに、前記回転基板の周縁部を前記蒸発源から覆うように該真空蒸着装置内に固定された固定膜厚補正板を備え、

前記固定膜厚補正板の先端部から前記回転基板の周縁部までの水平距離を  $L_1$ 、前記回転膜厚補正板における前記第 2 の回転軸から先端部までの水平距離を  $L_2$ 、前記回転膜厚補正板における第 2 の回転軸と前記第 1 の回転軸との離隔水平距離を  $X$ 、前記第 1 の回転軸から前記回転基板の周縁部までの水平距離を  $R$  とした場合、

$L_1 < R$ 、

$X < L_2 < R$ 、及び

$L_1 + L_2 \leq X + R$

である真空蒸着装置。